

# VOX3001

## 面発光レーザーVCSEL 生産用酸化装置



優れた酸化性能  
(面内均一性、再現性)

コンパクト

操作性向上

安全性向上

メンテナンス性向上

チャンバ	基板サイズ	3インチウエハ×1枚処理(トレイサイズ: 85)
	基板加熱機構	抵抗加熱(最高加熱温度/600)
	基板回転機構	Max.15rpm
	ガス導入ノズル	最高加熱温度/150
ガス供給系	流量制御	マスフローコントローラ方式
	気化方式	熱式気化方式(最高加熱温度/200)
真空排気系	ダイアフラムポンプ	
制御装置	インターロック用シーケンス用コントローラ及びソフトウェア	
酸化性能	画面均一性	20m ± 0.2m(周辺部除く3インチ基板面内)
	再現性	20m ± 0.2m(ラン to ラン) 但し、AlAs エピ膜の性能による
ユーティリティ	電力	三相 AC200V 10KVA 接地 第3種接地
	冷却水	流量 10L/min(最大) 5L/min(常用)、温度 23 以下 供給側圧力: 3kg/cm <sup>2</sup> G 以上 排水側背圧: 0.2kg/cm <sup>2</sup> 以下
	圧縮空気	供給側圧力: 5.5kg/cm <sup>2</sup> G 以上
	高純度窒素	供給側圧力: 70L/min(最大)、3kg/cm <sup>2</sup> G 以上

株式会社エピクエスト EpiQuest, Inc.

〒601-8142 京都市南区上鳥羽中河原 5 1

TEL 075-693-3356 FAX 075-693-3357

E-mail [info@epiquest.co.jp](mailto:info@epiquest.co.jp) URL <http://www.epiquest.co.jp>